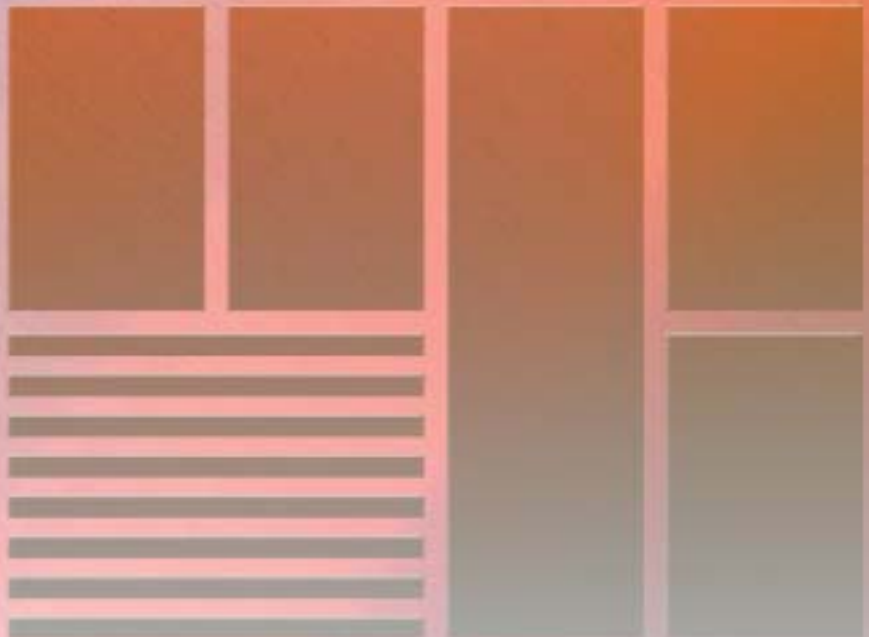


アニュアルレポート 2006
2006年3月期



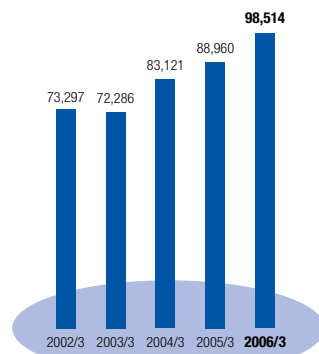
Pioneering

Future Dimensions



連結売上高

(百万円)

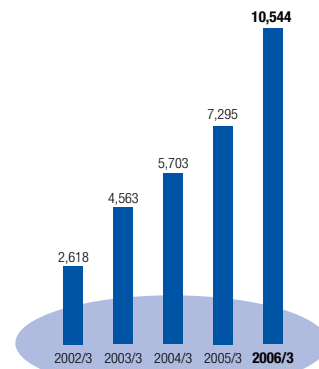


+10.7%

前期比10.7%増の
985億14百万円と
3期連続の増収

連結営業利益

(百万円)

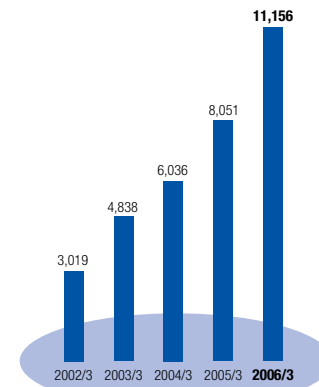


+44.5%

前期比44.5%増の
105億44百万円と
4期連続の増益

連結経常利益

(百万円)

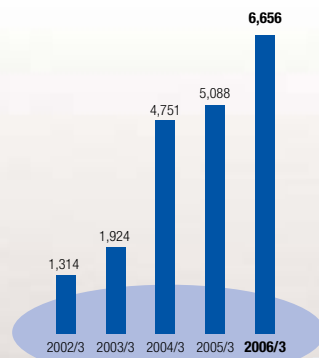


+38.6%

前期比38.6%増の
111億56百万円と
4期連続の増益

連結当期純利益

(百万円)

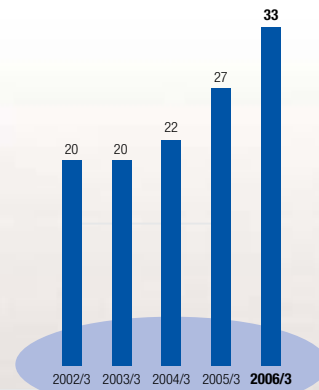


+30.8%

前期比30.8%増の
66億56百万円と
4期連続の増益

1株当たり年間配当金

(円)



+6円

前期の27円より
3期連続増配し33円
(含記念配当)

材料事業



47.8%

エレクトロニクス機能材料

半導体やフラットパネルディスプレイ、半導体パッケージ/実装、プリント基板等の微細加工に必要な材料として広く使用されているフォトレジスト*や半導体の進化に伴う配線の多層化に対応し層間絶縁膜・平坦化絶縁膜として用いられる被膜形成用塗布液等を提供しています。当社は、より高性能・高品質な製品を開発し供給することで、エレクトロニクス産業発展の一翼を担っています。

* フォトレジスト:光に反応して化学的に作用・変化する樹脂で、感光性樹脂とも呼ばれています。



29.0%

高純度化学薬品

フォトレジストの総合メーカーとして、その特性を熟知しているアドバンテージを生かし、現像液、剥離液、リンス液、シンナー等のフォトリソグラフィ関連材料をも幅広くラインナップしています。さらに、化粧品から電池製造、そして、食品添加物にいたるまで様々な産業分野で利用されている無機・有機化学薬品も取りそろえています。



4.7%

印刷材料

飲料缶や段ボール、フィルム等の凸版印刷に用いられる感光性樹脂版のほか、オフセット印刷に使われるPS版等、幅広く印刷製版材料を提供しています。環境に配慮したフレキソ印刷用感光性樹脂版の開発・改良を積極的に進め、印刷工程における合理化/無公害化/高品質化等のニーズにお応えしています。

装置事業



18.4%

プロセス機器

液晶パネル製造用のフォトレジスト塗布・現像装置や、各種半導体製造用装置を取りそろえています。これらの装置と、フォトレジストをはじめとする材料の両面から製品開発を行い、相乗効果を最大限に引き出すことで、お客様を強力にサポートしています。

注) 写真上の数字は連結ベースの売上構成比率です。また、装置事業につきましては、内部売上高を除いております。

目次

事業内容	1
社長メッセージ	2
中期計画 第3次「tokチャレンジ21」事業別の重点活動方針	8
コーポレート・ガバナンス/環境保全活動	10
会社情報	12
TOKグローバルネットワーク	13

2006年3月期の経営成績

第2次中期計画の最終年にあたる2006年3月期は、第2次中期計画で掲げた諸施策を着実に実行してきた結果、半導体分野、フラットパネルディスプレイ（FPD）分野および半導体パッケージ／実装分野での材料事業の順調な売上伸長に加え、装置事業につきましても、FPD分野での受注、販売ともに引き続き高水準な実績をあげることができましたため、第2次中期計画の業績目標を達成し、かつ、3期連続の増収と4期連続の増益を達成することができました。

この結果、当期の連結経営成績は、売上高は985億14百万円（前期比10.7%増）、利益面では原油価格高騰による原材料コスト上昇の影響はありましたが、営業利益は105億44百万円（同44.5%増）、経常利益は111億56百万円（同38.6%増）、当期純利益は66億56百万円（同30.8%増）となりました。また、営業利益率は10.7%、経常利益率は11.3%となりました。

当期の利益配当金につきましては、2005年3月期に実施いたしました創立65周年記念配当3円を普通配当とし、これに株式上場20周年記念配当3円を加えて、前期に比べ3円増配となる1株当たり18円とさせていただきます。これにより、中間配当金と合わせて、年間配当金は前期と比べ1株当たり6円増配の33円となり、3期連続の増配となりました。



取締役社長 中村 洋一

中期計画 第2次「tokチャレンジ21」の総括

2003年4月より実行してまいりました第2次中期計画では、「過去最高の利益（1998年3月期の連結経常利益約136億円）をキャッチアップするプロセスの構築」という課題を掲げ、「グローバル市場で勝ち残る企業」の実現に向けて、「微細加工技術の多角的展開」、「海外展開の強化」、「経営基盤の強化」を基本戦略とした様々な施策を講じてまいりました。

微細加工技術の多角的展開の施策と成果

「垂直的展開」の加速・追求

- 最先端半導体製造用材料の拡大（KrF、ArFエキシマレーザー用フォトレジスト）
- 新規微細加工プロセス、ソリューション・ビジネスの提案、展開（液浸露光技術、シュリンクプロセス）
- ナノプロセス開発部の設置

「水平的展開」の充実・拡大

- 新規分野、用途の開拓、新規プロセスや製品の研究・開発を遂行（液晶ディスプレイ製造用材料・装置、半導体パッケージ／実装用材料）
- 開発企画室、営業開発室の設置による新規事業の模索

コラボレーションの推進

- ウェハサポートシステムの共同開発（三洋電機株式会社）
- ナノコーティング材料の共同開発（独立行政法人理化学研究所）

研究開発の強化

- 新研究開発棟の建設

「微細加工技術の多角的展開」という戦略のもとでは、微細化の進展した半導体製造分野に代表されるように、それぞれの分野の先端領域での優位性確立に向け、さらなる微細化を追求する「垂直的展開」と、培った微細加工技術を新規分野や新規用途に広げる「水平的展開」を推進してまいりました。

その結果、垂直的展開においては売上の伸長が目覚ましい最先端半導体製造用材料や、水平的展開においては事業の柱の一つとなった液晶ディスプレイ（LCD）製造用材料および装置、順調に実績を伸ばした半導体パッケージ／実装用材料等、中期計画の業績目標達成に貢献した製品群を育成することができました。

さらに、液浸露光技術に対応する技術、製品の研究開発を進展させ、独自のシュリンクプロセスを開発してお客様ごとのニーズに応じた解決方法として提案を始めるなどの成果もありました。フォトレジストを使用するプロセスの最適条件やソリューションなどの開発・検討を行い、半導体製造分野での微細化の進展をビジネスチャンスとして生かすべく、お客様に個々の材料を提案することに留まらず、ニーズに応じて複数の材料を組み合わせソリューションとして提供するという、微細加工技術のソリューション・ビジネスへの発展を行えたことも、第2次中期計画の大きな成果であります。また、微細加工技術の多角的展開を加速、充実させるために、ウェハサポートシステムやナノコーティング材料での共同開発など、装置メーカー、サプライヤー、大学や研究機関等とのコラボレーションを積極的に行うと同時に、次世代に向けた研究開発棟新設等の積極的投資という施策のように、技術開発型の先進企業として将来の成長の原動力となる独自の研究開発にも注力してまいりました。フォトレジストサプライヤーでは世界初となる液浸露光対応のArFエキシマレーザー露光装置等を導入したこの新研究開発棟に対する投資は、次世代以降の技術領域での優位性を強固なものとすることができ、次世代以降における半導体製造分野での競争に参加するための必要不可欠な切符であると考えております。

「海外展開の強化」に向けては、韓国、中国、オランダに子会社を設立し、台湾では子会社での生産能力の増強を実施するなど、世界規模での最適な供給体制の整備と顧客により密接な販売体制の構築を行い、事業の拡大を推進してまいりました。その結果、第2次中期計画では特にアジア地域での売上を大幅に伸長でき、2006年3月期の海外売上高比率は中期計画目標の58.0%を上回る59.8%を達成しました。

「経営基盤の強化」につきましては、ERP（統合基幹業務システム）*の導入を行い、業務革新および情報システムの活用により業務の合理化、経営の効率化を推進するとともに、危機管理体制の強化も図ってまいりました。また、コンプライアンスに対する意識向上を図るとともに、共有する価値観と行動規範を明確にすることを目的として、「コンプライアンス行動基準」を制定し、施行するなど、コンプライアンス体制の整備・充実にも取り組んでまいりました。

この結果、実行された諸施策の進捗、および業績目標の達成から、第2次中期計画は一定の成果を得られたものと判断しており、過去最高の利益の更新を狙える状況が整ったと考えております。

* ERP（統合基幹業務システム）：企業の経営資源を有効に活用し経営を効率化するために、基幹業務を部門ごとではなく統合的に管理するためのシステム。

経営成績（連結）

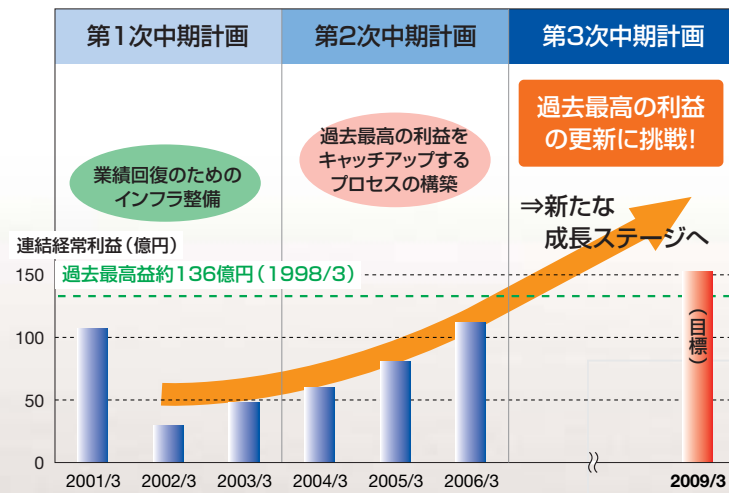
	2003/3 実績	2006/3 中計目標	2006/3 実績	対目標値
売上高	72,286	93,800	98,514	105.0%
営業利益	4,563	9,100	10,544	115.8%
経常利益	4,838	9,200	11,156	121.2%
当期純利益	1,924	5,000	6,656	133.1%
経常利益率	6.7%	9.8%	11.3%	+1.5%
海外売上高比率	48.5%	58.0%	59.8%	+1.8%

中期計画 第3次「tokチャレンジ21」の方針

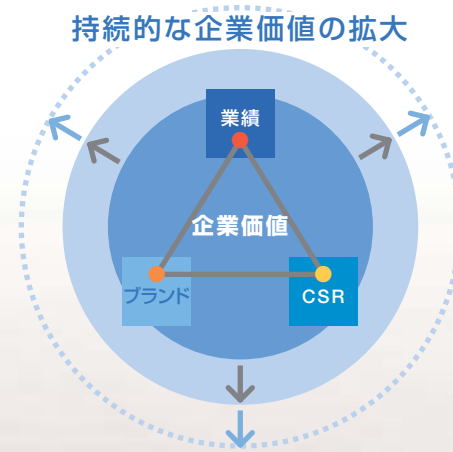
2006年4月にスタートした中期計画第3次「tokチャレンジ21」では、第2次中期計画で築きあげた成果を足掛かりとして、「高いCSR（企業の社会的責任）意識の下、顧客満足に徹し、技術の進化と人材開発に挑戦し、継続的に利益の出せる会社を構築する」ことに意を注ぎつつ、「企業価値の持続的な拡大への新たなステージ」へと歩を進めていくことを目標といたします。持続的な企業価値の拡大を図るためには、業績面の向上はもちろんのこと、CSRの推進、さらには「微細加工技術ならばTOK」というブランド力の確立、これら3つの要素を有機的に結合することが必要とされるという考えに立脚しております。

第3次中期計画では、目指すべき企業像である4つの経営ビジョンに基づき、3つの基本戦略を策定いたしました。また、この第3次中期計画の期間を「過去最高の利益の更新に挑戦」する期間と位置づけており、当社が「新たな成長ステージ」へと歩みを進めるための通過点であるとの認識のもと取り組んでまいります。なお、計画の最終年度2009年3月期での連結業績目標は売上高1,200億円、経常利益153億円としております。

第3次中期計画の位置づけ



第3次中期計画の基本的な考え方



経営ビジョン

- CSR（企業の社会的責任）意識の高い会社
- ファインケミカル分野の世界市場で、高いシェアを有し、利益率の高い製品を数多く有する会社
- 収益力が高く、財務内容の健全な会社
- ステークホルダーから高い信頼と満足を寄せられるブランド力のある会社

基本戦略

- 微細加工技術の進化
- グローバル市場でのTOKブランドの確立
- 経営体質の強化・企業風土改革

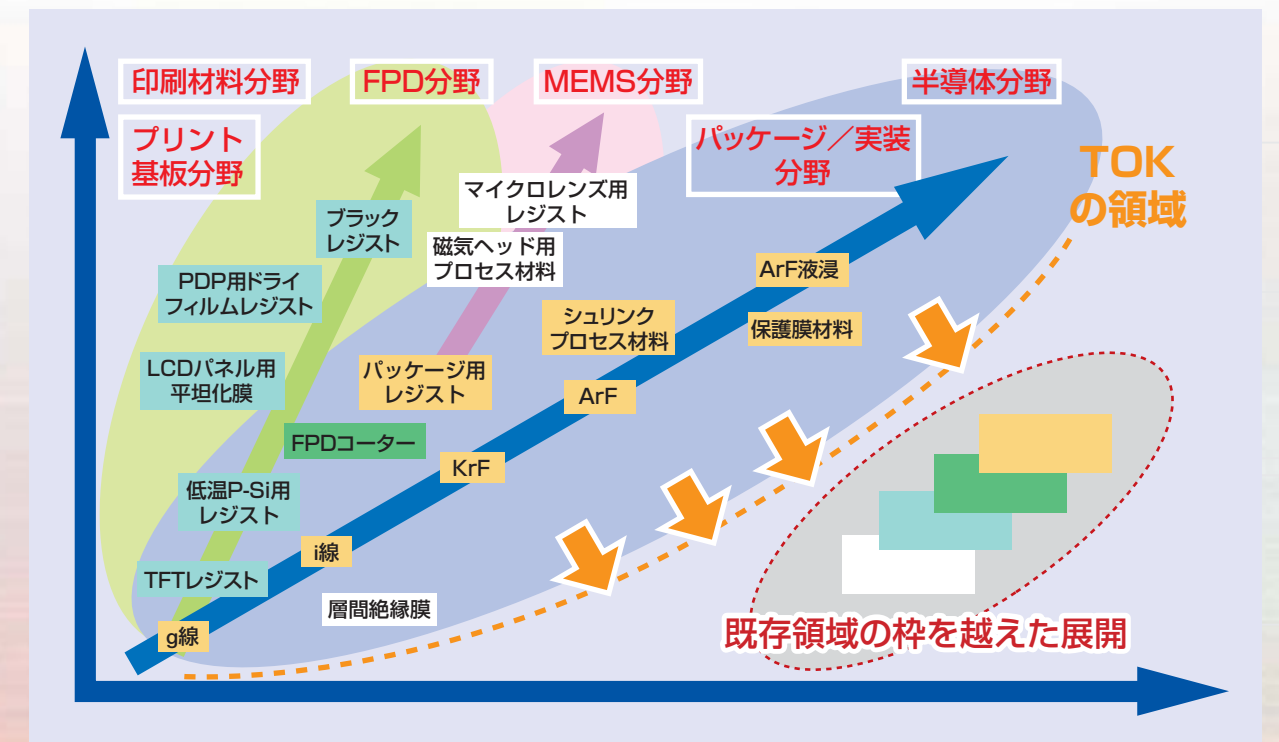
基本戦略—微細加工技術の進化

フォトポリマー技術等の微細加工技術は、当社が長年追求してきたコアコンピタンスであり、企業価値を生み出す本源であります。第3次中期計画においても、既存領域における優位性を堅持しつつ、市場のシーズ・ニーズを捉えてさらに微細加工技術の枠を拡大し続ける研究開発に注力してまいります。第2次中期計画で深化（垂直的展開）と拡大（水平的展開）を図った「微細加工技術の多角的展開」を、第3次中期計画ではより「進化」させ、「垂直的展開」においては単独の製品の提供ではなく複合技術の組み合わせによる微細化の提案を行い、一方、「水平的展開」においては既存技術の「転用」ではなく「応用」、さらには「発想の転換」を行う「微細加工技術の進化」を基本戦略として推進し、成長事業領域へ経営資源を集中させ、既存の事業領域の枠を越えた新規事業領域を創出してまいります。

これまで取り組んでまいりました「微細加工技術の多角的展開」では、技術的な繋がりを重視した展開を図り、その領域はエレクトロニクス業界を中心としたものとなっております。

今回の「微細加工技術の進化」では、持続的成長を支える「種」を得るため、技術の新たな開発、応用、機能の分化、変異を重視することにより、既存の技術領域や分野の枠を越え、将来において事業の中核となり得る新たな事業領域を創出してまいります。すなわち、従来のエレクトロニクス分野に留まらず、市場のシーズ・ニーズを的確に捉え、微細加工技術の展開を図ることにより、それがニッチな分野であっても世界シェアNo.1を獲得できる新分野、新領域を開拓して、次世代に継承できるビジネスの育成を追求していくということとなります。

微細加工技術の進化



基本戦略—グローバル市場でのTOKブランドの確立

微細加工技術の進化を図り、企業価値の拡大に結びつけるためには、「グローバル市場でのTOKブランドの確立」が東京応化のポテンシャルを最大限に引き出す「ドライバー」となるものと考えています。技術開発のスピードとタイミングの重要性が増している状況下においては、市場のニーズをいち早く、かつ、広範に捉えることがますます重要になってきております。「TOKのブランドを確立」していくことは、企業価値の持続的拡大に対して必須となるものと考えております。

具体的に「グローバル市場でのTOKブランドの確立」とは、グローバル市場において競合他社に先んじて顧客からの声が自然かつ必然的に東京応化に寄せられる状況を作り上げることであり、また、言い換えれば、東京応化が提供する微細加工技術におけるソリューションに対して顧客からの期待をいかに高めるかということでもあります。そのためにはユーザーとの強い信頼関係に裏付けられた「ブランド力」が必要であり、「世界トップクラスの半導体フォトリソトリード事業を生かした既存の他分野への展開」、「顧客満足度の徹底」および「海外拠点の充実」により強固な「TOKブランド」の確立を目指してまいります。

フォトリソグラフィを用いた微細加工技術は幅広い分野で活用されておりますが、なかでも100nm(1nmは、1,000,000分の1mm)以下というナノテクノロジーの領域にある半導体製造分野は、際立って微細化の進展した最もチャレンジングな分野といえます。この分野での最先端技術に対する研究開発は、微細加工技術の進化に欠くことのできない最重要領域であり、また、最も開発の困難な領域でもあります。この領域・分野で、実績をあげることが、研究開発力、品質管理力、営業力、財務力等、会社の総合力に対する高い評価に結びつくことから、東京応化では「フラッグシップ」と位置づけております。この領域において戦略的な研究開発に取り組むとともに、最も困難な先端領域にチャレンジし、そして実績を積み重ねることによって、リーダーシップを発揮してまいりたいと考えております。さらに、開発した新技術を他の分野に展開し、微細加工技術における確固たる優位性を築くことが、「TOKブランド」の確立に繋がると考えております。

また、これまで培ってきた微細加工技術のノウハウを最大限に活用、運用することで、技術開発型企業として、品質、技術サポート、価格および物流等のすべての要素において、「顧客満足度の徹底」を図り、第2次中期計画までにグローバル規模に整備を行ってきた拠点の機能と役割を最大限に果たしていくとともに、当社を核にグループ内の連携を密にし、効率的に機能させることで、「海外拠点の充実」を推し進め、グローバル市場での「TOKブランド」を確立してまいります。

そして「微細加工ならTOK」とお客様から支持や信用・信頼感を寄せられる企業の確立が、持続的な成長、発展への礎となるものと確信しております。

基本戦略—経営体質の強化・企業風土改革

第3次中期計画では、第2次中期計画で確立した経営基盤をさらに発展させ、「部分最適から全体最適へ」を念頭に置いた経営体質の強化を図ってまいります。

これからの時代に求められる企業のあり方は大きく変化しており、事業のグローバル化へ対応し、また、多様化するステークホルダーの要請に応えるべく、CSR経営を推進していくとともに（詳細は「環境・社会報告書」をご覧ください）、内部統制システムの構築にも注力してまいります。また、一方で、既に導入したERPやその他のITシステムを定着させ引き続き経営の合理化・効率化にも取り組み、総合的な「経営体質の強化」を進めてまいります。

また、企業風土につきましても、「常に危機感と夢を持ち続け、現状に満足することなく、環境の変化に柔軟に対応できる人材の育成と組織の実現に挑戦する」をスローガンに掲げ、すべての社員一人ひとりが常にCSRの担い手であり、「TOKブランド」の担い手であるという意識を持ち、そして誇りと夢をもって業務に当たり、ものづくりの原点ともいべき現場力を向上させてまいります。長い歴史と経験から培われた東京応化の良き風土を次世代に継承し、変化していく社会環境に適さないものは大胆に改革し、激変していく環境に柔軟に対応する企業風土を醸成していくことが肝要と考えております。

高い信頼と満足寄せられる企業を目指して

第2次中期計画の諸施策による成果を足掛かりとして、中期計画第3次「tokチャレンジ21」に基づき、過去最高の利益の更新に挑戦し、企業価値を高め持続的成長が可能な企業を目指してまいります。その実現のために、微細加工技術を核とする最先端技術領域での研究開発を推し進め、高い信頼感を有する「TOKブランド」の確立に努めてまいります。また、顧客満足度の一層の向上、CSRを強く意識した企業活動を推進し、多くの皆様から高い信頼を寄せられる企業として発展できるよう最善を尽くしてまいり所存です。

今後もステークホルダーの皆様のご期待に応え、魅力ある企業であり続けるよう取り組んでまいりますので、一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

2006年10月

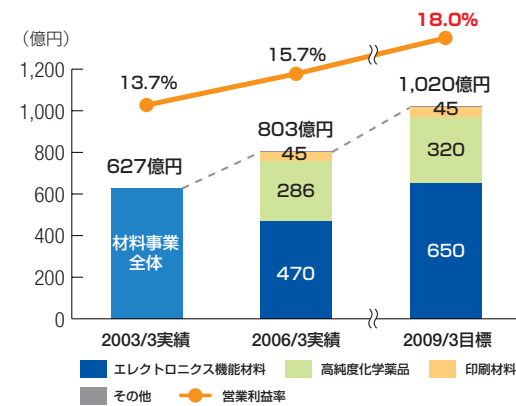
取締役社長 中村洋一



■材料事業

各分野の先端領域で、エレクトロニクス機能材料を中心として積極的な展開を図り、「微細加工技術の進化」を図るとともに「TOKブランドを確立」していくことで、事業の拡大を図ってまいります。

材料事業の業績目標（連結）

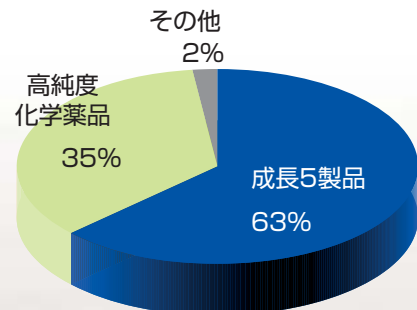


成長製品群の売上

第2次中期計画の売上実績

—最終年度 2006年3月期—
(2003年3月期比176億円増加)

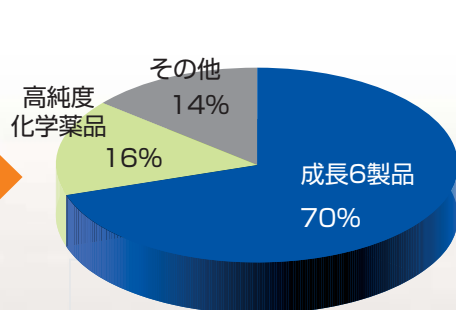
増加176億円の内訳



第3次中期計画の売上目標

—最終年度 2009年3月期—
(2006年3月期比216億円増加)

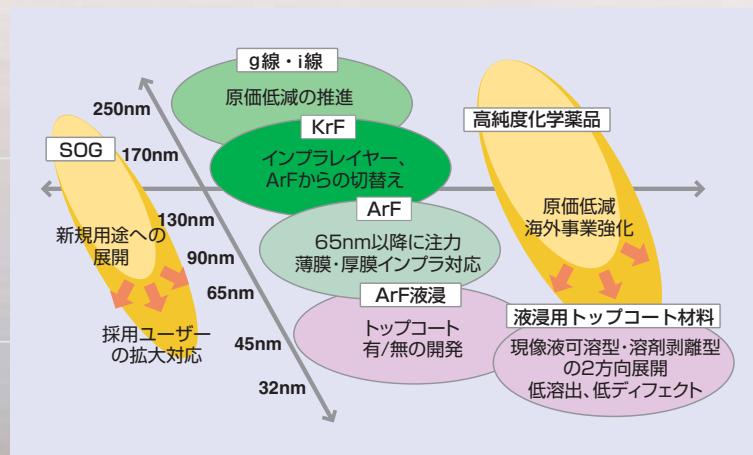
増加目標216億円の内訳



成長6製品=「第2次中期計画における成長5製品」+「1製品」
「KrFエキシマレーザー用フォトレジスト」、「ArFエキシマレーザー用フォトレジスト」、「TFTアレイ用フォトレジスト」、「カラーフィルター用ブラックレジスト」、「PDP材料」+「半導体パッケージ/実装材料」

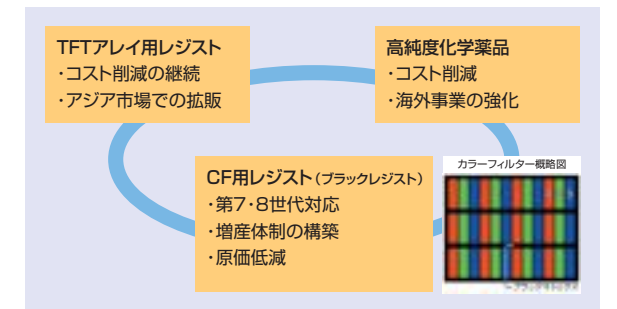
●電子材料事業の活動方針

- 液浸露光対応ArFエキシマレーザー用フォトレジストおよび関連材料の開発を加速。新研究開発棟に液浸露光対応のスクャナー（露光装置）をいち早く導入した優位性を活用して先行
- KrFエキシマレーザープロセス以降の先端領域における製品の拡充とさらなるシェア拡大



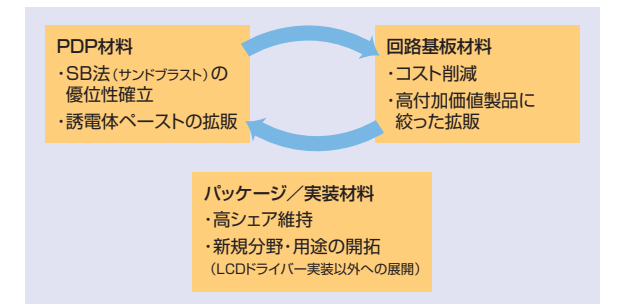
●液晶材料事業の活動方針

- 製品開発のスピードアップと価格対応力の強化
- 国内外における安定した生産・供給体制の構築



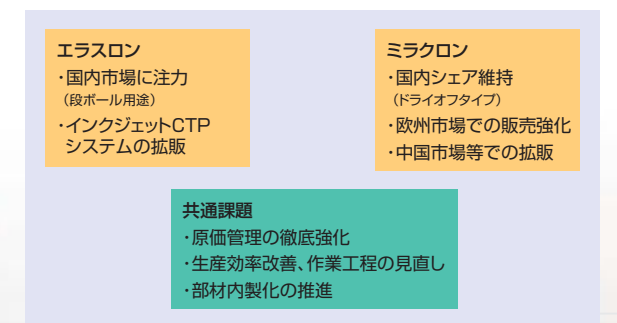
●PDPパッケージング材料事業の活動方針

- 市場ニーズを把握したプラズマディスプレイ製造用材料の充実
- 多様な技術の応用と進化による半導体パッケージ/実装材料における新たな分野への展開



●印刷化材事業の活動方針

- 原価管理の徹底等による安定した収益確保
- 製品ラインナップの強化



■装置事業

液晶パネル製造装置を事業の中心と位置づけ収益力の向上を図るとともに、さらに微細加工技術の新規用途の開拓にも取り組んでまいります。

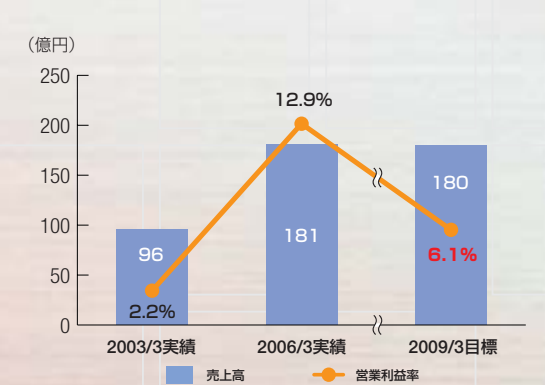
●液晶カラーフィルター用塗布装置(コーター)の活動方針

- コストダウンの追求による収益力の強化
- 第8世代以降に対応する装置の早期開発

●M&E (Materials & Equipment) 戦略の推進

- 材料事業とのシナジー効果が期待できる“ポスト・コーター事業”の創出
例) ウェハ薄化プロセス用ウェハサポート関連装置の開発 既存技術の新規用途への展開

装置事業の業績目標（連結）



コーポレート・ガバナンス

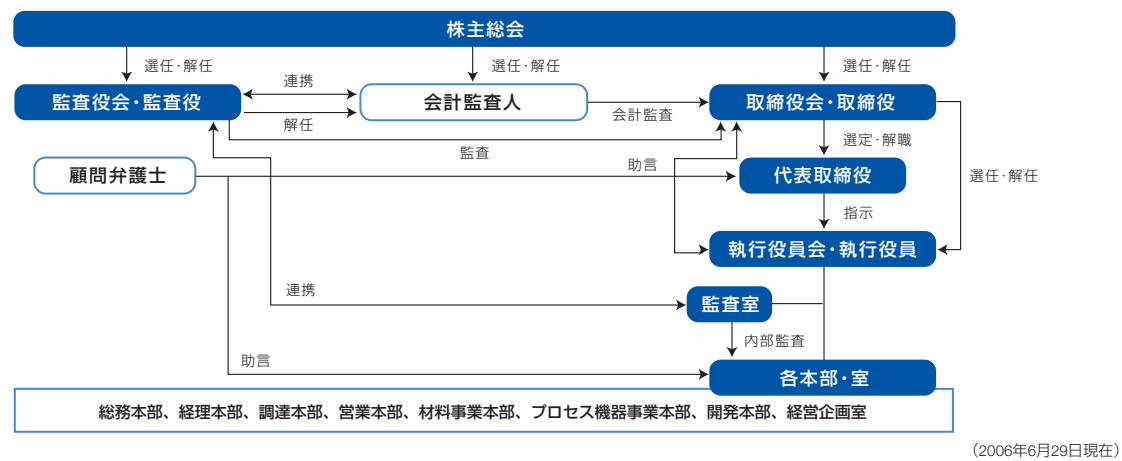
当社は、ステークホルダーの皆様からより高い信頼と満足を寄せられる企業を目指し、経営の透明性、健全性ならびに意思決定の迅速化等による効率性の確保を目的としたコーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題の一つと位置づけ、その達成に向けて取り組んでおります。

会社の機関等の内容

当社は、監査役設置会社として引き続き監査役制度を採用しております。これは、商法等の改正に伴い重要度が増した監査役による監査の充実を図るとともに、取締役会の改革と2003年に導入した執行役員制度の定着により各機能の強化と責任の明確化を図ることによって、経営を強化していくことがコーポレート・ガバナンスの充実に最も有効と判断しているためです。

なお、経営環境の変化に迅速に対応するとともに、事業年度における取締役の経営責任を明確にするため、2006年6月29日開催の第76回定時株主総会において取締役の任期を2年から1年とする一方、取締役会の透明性を高めるとともに、監督機能の強化を図るため、同株主総会において新たに社外取締役を1名選任いたしました。

コーポレート・ガバナンス体制



取締役・取締役会

役付取締役を取締役会長と取締役社長（いずれも代表取締役）に限定する一方、その他役付取締役を置かないことにより、原則として取締役会を「代表取締役」と「取締役」にし、取締役会に本来求められる「経営意思決定・経営監督」機能の発揮に適した体制としております。

2006年3月31日現在、取締役は8名で、業務執行に関する重要事項等を決定するとともに、代表取締役および取締役の職務執行を監督することを目的に、定時取締役会を原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。

なお、2006年6月29日開催の第76回定時株主総会終結後、取締役は7名（うち、社外取締役は1名）となっております。また、同株主総会終結後の取締役会において、取締役社長（代表取締役）に加え、新たに2名の代表取締役を選定いたしました。

執行役員・執行役員会

取締役会の「経営意思決定・経営監督」機能の充実を図る一方、「業務執行」機能のさらなる強化に向け、「執行役員社長」以下、「専務執行役員」、「常務執行役員」、「執行役員」等の階層的な役位を設定するとともに、全執行役員で構成する「執行役員会」を設置しております。

2006年3月31日現在、執行役員は15名で、取締役会における決定事項の指示・命令、執行役員相互の活動情報の共有化および取締役会付議基準未滿の一定の重要事項の意思決定等を目的に、定時執行役員会を原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時執行役員会を開催しております。

なお、2006年6月29日以後、執行役員は14名となっており、その構成は、「執行役員社長」以下、「専務執行役員」、「常務執行役員」、「執行役員」となっております。

監査役・監査役会

2006年3月31日現在、監査役は4名（うち、社外監査役3名）で、監査に関する重要事項について各監査役から報告を受け、協議を行い、または決議することを目的に、定時監査役会を原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。

なお、2006年6月29日開催の第76回定時株主総会終結後、監査役は3名（うち、社外監査役は2名）となっております。

監査室

内部統制の一環として、取締役社長直轄の監査室を設置し、専任スタッフが監査役との関係を取りながら定期的に必要な内部監査を実施し、法令や社内規程等の遵守状況の調査と指導を行っております。

コンプライアンスに関する主な取組み

全従業員一人ひとりのコンプライアンスに対する意識向上を図るとともに、共有する価値観と行動規範を明確にすることを目的として、2004年10月6日付で制定した「TOKグループ・コンプライアンス行動基準」を2005年4月1日より施行しております。さらに、この施行に合わせて、各種法令・行動基準違反等の事実の早期発見・解決を図る目的で、内部通報制度を整備し、運用を開始しております。同制度の運用にあたっては、通報者保護のため、当社内に設置する「コンプライアンスほっとライン」（社内ルート）に加え、当社顧問弁護士（弁護士事務所）への通報ルート（社外ルート）を設けることにより、状況に応じて通報先を選択できるよう便宜を図るとともに、内部通報した際には、不誠実かつ不当な目的で行った場合を除き、これを理由として解雇その他不利益な扱いをしない方針を明確にしております。

なお、法令・行動基準違反等の事例が生じた場合には、取締役社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」において調査・検証を行ったうえで、必要に応じて適切な処分を下すこととしております。併せて、以後同様の事例が生じることのないよう、再発防止策を決定し、社内に周知徹底させることとしております。

環境保全活動

化学産業は、多くの化学物質を取り扱う事業が多いことから環境に多大な影響を及ぼす可能性があることと認識しております。しかし、人々の暮らしに多くの利益・利便性をもたらす重要な産業でもあります。

当社は、レスポンシブル・ケアの精神にのっとり「製品開発から廃棄にいたる全ライフサイクルにわたって自己決定・自己責任の原則に基づき安全を確保し、健康、環境を守るために最善を尽くす」という意識を持って日々取り組んでおります。そして、従来の大量生産・大量消費・大量廃棄の社会構造と対極にある循環型社会の実現に向けて、ゼロエミッションを目標とした環境経営を推進しております。詳細につきましては、「環境・社会報告書」を発行し、1年間の環境保全活動と社会とのかかわりについて報告しております。

今後とも当社は「企業と社会の持続的な発展を担いながら、地球環境を守る」ことを常に念頭に、環境経営の推進に努めてまいります。

会社概要

(2006年3月31日現在)

社名	: 東京応化工業株式会社	上場証券取引所	: 東京証券取引所市場第一部
設立	: 1940年10月25日	お問い合わせ先	: 広報部
本社	: 〒211-0012 川崎市中原区中丸子150番地		: 〒211-0012 川崎市中原区中丸子150番地
従業員数	: 1,484名(単独)	TEL	: 044-435-3000
資本金	: 146億4,044万8千円	FAX	: 044-435-3020
株主数	: 9,641名		
ホームページ	: http://www.tok.co.jp/		



役員一覧

(2006年10月1日現在)

取締役

代表取締役 取締役社長	執行役員社長	中村 洋一	
代表取締役	専務執行役員	小峰 孝	開発本部長
代表取締役	専務執行役員	開発 宏一	総務本部長
取締役	常務執行役員	逸見 至保	経理本部長兼財務部長
取締役	執行役員	任田 博行	材料事業本部長兼画像材料事業部長
取締役	執行役員	岩崎 光文	営業本部長
取締役		牧野 二郎	株式会社牧野フライス製作所取締役社長

監査役

常勤監査役	木谷 佳夫	
監査役	檜垣不二夫	菱進ホールディングス株式会社取締役社長
監査役	羽山 幸男	

執行役員

常務執行役員	堀越 昭則	経営企画室長兼企画部長
執行役員	古谷 仁	調達本部長
執行役員	小原 秀克	プロセス機器事業本部長
執行役員	宮城 豊	プロセス機器事業本部副本部長
執行役員	大田 勝行	営業本部副本部長兼業務管理部長
執行役員	浅羽 洋	材料事業本部副本部長兼電子材料事業部長
執行役員	田澤 賢二	TOKYO OHKA KOGYO EUROPE B.V. 取締役社長
執行役員	駒野 博司	開発本部副本部長兼開発企画室長

※ 取締役 牧野二郎氏は、社外取締役であります。
 ※ 監査役 檜垣不二夫および監査役 羽山幸男の両氏は、社外監査役であります。



- TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.
Singapore Representative Office
8 Shenton Way, #14-01A, Temasek Tower, SINGAPORE
TEL.+65-62261485 FAX.+65-62261893
Shanghai Representative Office
1511, China Merchants Tower, 161 Lu Jia Zui East Road,
Pu Dong Xin Qu, Shanghai 200120, CHINA
TEL.+86-21-5840-8800 FAX.+86-21-5840-8884
- TOKYO OHKA KOGYO AMERICA, INC.
【フォトレジスト、高純度化学薬品の製造・販売】
Headquarters / Oregon Plant
4600 N.W. Shute Road, Hillsboro, Oregon 97124, U.S.A.
TEL.+1-503-693-7711 FAX.+1-503-693-2070
Corporate Sales Office
190 Topaz Street, Milpitas, California 95035, U.S.A.
TEL.+1-408-956-9901 FAX.+1-408-956-9995
- TOKYO OHKA KOGYO EUROPE B.V.
【フォトレジスト、高純度化学薬品、印刷材料などの販売】
Headquarters
Databankweg 12, 3821AL Amersfoort, THE NETHERLANDS
TEL.+31-33-4543522 FAX.+31-33-4519646
- TOK ITALIA S.p.A.
【ドライフィルムレジスト、高純度化学薬品の製造・販売】
Headquarters / Plant
Via Camillo Chiesa, 30, 20010 Pogliano M.SE (MI), ITALY
TEL.+39-02-93559006 FAX.+39-02-93559007
- TOK TAIWAN CO., LTD.
【高純度化学薬品の製造・販売、フォトレジスト、製造用装置の販売】
Headquarters
10F., No.675, Sec.1, Jingguo Road, Hsinchu City 300,
TAIWAN
TEL.+886-3-5345953 FAX.+886-3-5350178
- TOK KOREA CO., LTD.
【フォトレジスト、高純度化学薬品の販売】
Headquarters
15F., DukHeung Bldg., 1328-10, Seocho-dong, Seocho-gu,
Seoul 137-858, KOREA
TEL.+82-2-588-5035 FAX.+82-2-588-5036
- CHANG CHUN TOK (CHANGSHU) CO., LTD.
【高純度化学薬品の製造・販売】
Headquarters / Changshu Plant
Changchun Road, Riverside Industrial Park, Changshu
Economic Development Zone, Jiangsu Province 215537,
CHINA
TEL.+86-512-5264-8000 FAX.+86-512-5264-9000

将来見通しに関する注意事項

本アニュアルレポートに記載の将来に対する見通し、予想等につきましては、その時点までに入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいております。したがって、実際の業績は様々な重要な要因により、この業績見通しとは大きく異なる結果となる可能性があるため、この業績見通しのみで全面的に依拠されませんよう、お願いいたします。また、その時点以降に修正されている場合があるため、最新の資料をご入手いただくなど、必ずご確認くださいませますよう、お願いいたします。

〒211-0012
川崎市中原区中丸子150番地
TEL. 044-435-3000 (代表)
FAX. 044-435-3020
<http://www.tok.co.jp/>

tok 東京応化工業株式会社

R100



このレポートは古紙配合率100%再生紙を使用しており、
かつ環境に配慮した大豆油インキを使用しています。

06 1000.5 NIR. AUMZ